

第188回ラドテック研究会講演会

期 日：2025年1月23日（木） 13：00～16：40
会 場：早稲田大学 121号館コマツ100周年記念ホール
主 催：一般社団法人ラドテック研究会
協 賛：一般社団法人近畿化学協会・一般社団法人色材協会・合成樹脂工業協会
一般社団法人日本接着学会・フォトポリマー懇話会
一般社団法人有機エレクトロニクス材料研究会 （予定 順不同）

<プログラム>

敬称略

1) 13：00～13：50（質疑応答含む）

「動的光重合による分子配向と高効率高分子合成」

東京科学大学 宍戸 厚

本講演では、われわれが開発した動的光重合法を紹介する。液晶モノマーを動的な光照射により重合することにより、複雑な分子配向を一段階でパターンニングできる。さらに、本手法を汎用モノマーに適用することで、高分子量のポリマーを低露光量で合成できる。

2) 13：50～14：40（質疑応答含む）

「有機フォトクロミック化合物の表面レリーフ形成材料への応用」

横浜国立大学 生方 俊

空間パターンを有する光に応じて物質が移動することで形成する表面レリーフ。本講演では様々な有機フォトクロミック化合物薄膜に形成される表面レリーフについて紹介する。

14：40～15：00 休憩

3) 15：00～15：50（質疑応答含む）

「チオール系硬化剤・増感剤の使用方法和市場動向」

堺化学工業株式会社 山内 豊直

チオール化合物はSH基の高い反応性と特長的な樹脂物性を発現することから、エポキシやアクリレート樹脂の熱・光硬化系に用いられている。今回、チオールの一般的な物性ととも、近年求められる低温硬化（速硬化）、耐湿熱性、耐衝撃性に優れたチオール化合物について紹介する。

4) 15：50～16：40（質疑応答含む）

「加飾技術の最新動向と今後の展望」

D plus F Lab 伊藤 達朗

製品表面の質感を向上させる目的で、様々な加飾技術が開発・適用されている。また今後は、意匠性プラス「機能との融合」「環境対応」「少量多品種対応」が求められてきている。今回講演では、加飾技術の最新動向を解説し、今後の加飾プラス付加価値付与について展望する。

17：00～18：30 賀詞交換会

※プログラムは変更になる場合がございます。